



行业动态
Industry News



- ▣ 科普首页
- ▣ 微电子历史
- ▣ 行业动态
- ▣ 术语解释
- ▣ 无微不至
- ▣ 芯片制程
- ▣ 科普创意

配备先进浸入式光刻设备 NEC电子明年底在NEC Yamagata投产40nm工艺系统LSI

2007-11-30 | 编辑: | 【大 中 小】 【打印】 【关闭】

NEC Electronics近日宣布计划在其全资子公司NEC Yamagata生产40nm工艺的系统LSI (Large Scale Integrated circuit 大规模集成电路)。2007财年(截至2008年3月31日)公司投入100亿日元,为目前的300mm生产线配置了可生产55nm及40nm产品的浸入式光刻设备。

NEC Yamagata于06年12月开始量产65nm产品,在今年10月份开始供应55nm工艺样品,55nm产品除采用浸入式光刻技术外还采用了高K栅极绝缘膜,该基本工艺也可用于40nm产品。因此,55nm和40nm工艺可共用该生产设备。40nm产品预定在08年底开始生产,生产品种包括面向数字家电、便携设备、游戏机的系统LSI,以及DRAM混载的系统LSI等。

NEC Yamagata目前拥有13000片每月的300mm晶圆处理能力。通过此次的设备引进,其中的5000片支持55nm和40nm工艺。在这5000片中,2000片支持40nm工艺。

NEC Yamagata自2005年1月开始基于300mm晶圆的生产以来,至今共投资约1400亿日元。今后还计划向NEC Yamagata陆续投入40nm产品生产必需的设备。

(来源:半导体国际)